



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

## 旋转磁控电弧离子镀弧源

文献类型: 专利

**作者** 闻立时, 郎文昌, 孙超, 宫骏, 赵彦辉 and 肖金泉

**发表日期** 2009-02-11

**专利国别** 中国

**专利类型** 发明专利

**权利人** 中国科学院金属研究所

**中文摘要** 本发明涉及薄膜制备领域,具体地说是一种利用旋转磁场控制弧斑运动的旋 转磁控电弧离子镀弧源。在靶材周围空间设有旋转磁场发生装置,旋转磁场发生 装置为采用相差一定均匀角度、相互连接在一起的几个磁极均匀布在同一圆周上,磁极数量为 $4n$ 或者 $3n, n \geq 1$ ,形成一个整体的电磁回路骨架,励磁线圈套在磁 极上或者嵌在相邻磁极之间的槽隙内,采用相位差 $90^\circ$ 的两相或者相位差 $120^\circ$ 的三相励磁顺序供电,在磁极包围的空间内产生可调旋转磁场。本发明通过可调 速调幅的旋转磁场控制弧斑的运动,可以改善弧斑的放电形式和工作稳定性,提 高靶材刻蚀均匀性和靶材利用率,减少...

**公开日期** 2009-02-11

**语种** 中文

**专利申请号** CN101363115

**源URL** [<http://210.72.142.130/handle/321006/66408>] [↓](#)

**专题** 金属研究所\_中国科学院金属研究所

**推荐引用方式** 闻立时, 郎文昌, 孙超, 宫骏, 赵彦辉 and 肖金泉. 旋转磁控电弧离子镀弧源. 2009-02-11. **GB/T 7714**

入库方式: OAI收割  
来源: [金属研究所](#)

浏览	下载	收藏
112	0	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

